

SOFCにおけるX線応力測定報告例





試験片を傾斜させ、X線回折法で、異なった傾斜角(Ψ)をもつ面間隔を区別して測定

引張り応力が存在する場合、傾斜角が大きいと同じ面でも面間隔が大きくなるので、回折ピーク位置は低角側にシフトする。

↓ ピーク位置がシフトする方向から引張り状態、圧縮状態を区別できる シフトの大きさから引張り応力の強さが分かる

横軸にsin²Ψをとり回折ピーク位置をプロットすると理論上直線に乗り、勾配は応力値に比例する。 勾配=存在する応力×材料固有の定数



X線回折装置





ひずみ測定に用いるピークは、電極と電解 質とで重ならないよう、以下のピークを選 択した。

	構成材料	回折面	2 theta / deg (at 37 keV)
アノード	Ni	331	23.95
	NiO	511/333	24.05
	SDC	622	23.59
電解質	LSGMC	422	24.29
カソード	SSC	332	23.83

測定したのと同じ回折面でのX線的弾性定数を別途実験により求めた。



侵入深さ一定法

ー定の深さでの歪みを測定するため、セルの傾斜角を変 化させる度に $\omega(並傾角) \ge \chi(側傾角)の両方を調整し、$ 正味の傾斜角を変化させても侵入深さを一定に保つようにした(侵入深さ一定法)。

このような測定を侵入深さを変えて実施した(侵入深さ: 概 ね5 μm、10 μm、15 μm···)。





測定セルの履歴

得られたデータ例(セルA:アノード側)







進入深さに対する残留応力の変化(換算結果)



・還元によりアノード側のNiおよびSDCに存在する残留応力が減少した。 ・電解質表面付近に存在する残留応力は、ジルコニア系電解質を用いた報告例と同様になった。 ・電解質内部またはセル端部付近に引っ張り応力が存在することにより内部応力がつりあうと考えられる。